

fastmicro

掩膜版 | 保护膜表面颗粒物 快速检测系统(PDS)

FM-PR-PDS I 手动和自动载样



FM-PDS: 直接检测表面颗粒

该系统可为掩膜版、掩膜版保护膜以及基板(衬底)制造工艺,提供 高通量的表面颗粒污染检测服务。

该系统对粒径大于 0.1μm 的颗粒具有高灵敏度,是一种高效且提供全方位服务的选择。它能以手动或自动的操作方式,以及较低的维护成本,取代传统的颗粒检测系统。

对于下一代半导体生产应用, PDS 系统具备独特的属性:双面同时扫描(选配);静态视场扫描(在图像采集过程中无需移动产品)。

生产过程中的一致性测量

1 快速: 能在数秒内完成大面积成像

(2) 定量: 适用于生产和研发环境中的质量鉴定与监测

③ 操作简便:不受操作人员影响,自动化,洁净抓取方式

4 精准: 高分辨率测量(数量、位置、尺寸)

5 一致性: 每次测量都保持客观、稳定

(6) 高通量: 能在工艺时间窗口内得出结果

多功能模块化平台

该系统专为直接测量 DUV(深紫外)和 EUV(极紫外)掩膜版保护膜、掩模版或其他类型基板表面的颗粒污染水平而研发。







该系统可根据需要客户需求进行定制和扩展。测量模块也可为系统集成商和原始设备制造商(OEM)提供贴牌服务

Fastmicro 致力于帮助客户解决亚微米级洁净度检测的难题。我们相信,通过快速、精准、量化的表面颗粒测量,能帮助您实现洁净控制的技术突破。

我们的解决方案可以帮助工艺工程师精准决策工艺优化方向,持续交付高质量产品,最终为终端用户提供卓越性能的设备。



技术规格

掩膜版 | 保护膜表面颗粒物 快速检测系统(PDS)

高通量检测	高通量:每小时可检测 400 片晶圆 (WPH)可在数秒内完成 4 至 12 英寸掩膜版 保护膜成像
数据输出与控制	 检测结果:累积颗粒计数、位置和尺寸数据 颗粒随时间累积的数据可展示在分析界面 输出:支持 KLARF 和.csv 文件(包括标准粒度分级)的导出功能 可根据 ISO 14644-9 标准,在用户界面和 PDF 报告输出 SCP 等级 全数字控制,以太网连接 可选:SECS/GEM 工厂自动化和 GEM300 集成
操作便捷	 测试结果不受操作人员影响 独立于设备的外部用户操作界面 可选手动或自动载样 配备专用基板夹具的五轴双机械臂机器人搬运系统 通过自定义程序设计实现多应用目的
检测范围	• 能够检测 ≥ 0.1μm 聚苯乙烯乳胶 (PSL) 等效颗粒 (经 NIST 认证)
正反两面检测	• 可选: 升级为单次测量中完成正反两面检测(无需翻转)
重复性	• 对于大于 0.1 μm 的 PSL 等效颗粒 (经 NIST 认证),累积颗粒计数重复性超过 99%
尺寸和位置精度	• 对于大于 $0.1\mu m$ PSL 等效颗粒 (经 NIST 认证),精度在 20% 以内
使用及维护	无接触和移动部件,极少产生颗粒,保持高洁净度测量过程无移动和摩擦,维护间隔长拥有成本低,提供全方位服务
要求	• 产品表面粗糙度 Ra < 50 nm
型号与占地面积	 FM-PRM-PDS-V01 Pellicle - Reticle Manual: LxWxH 660 x 1335 x 2047 mm FM-PRA-PDS-V01 Pellicle - Reticle Automated: LxWxH 1320 x 1335 x 2047 mm

复纳科学仪器(上海)有限公司

